

# USA dávají ASML na EUV úsilí

 [eetimes.com/u-s-gives-ok-to-asml-on-euv-effort](http://eetimes.com/u-s-gives-ok-to-asml-on-euv-effort)

Maurizio Di Paolo Emilio

February 24, 1999

Od Davida Lammerse 24.2.1999 0

Sdílet příspěvek

Sdílet na Facebooku

Sdílejte na Twitteru

WASHINGTON – Americké ministerstvo energetiky (DOE) oznámilo dohodu s ASM Lithography (Eindhoven, Nizozemsko), která by této společnosti umožnila podílet se na vývoji extrémní ultrafialové (EUV) litografie, která nyní probíhá v Livermore v Kalifornii.

Dohoda řeší konfliktní otázky, jak začlenit ASM Lithography (ASML) do EUV Limited Liability Corp., konsorcia tří amerických výrobců polovodičů, amerických prodejců litografie a výzkumníků ze tří národních laboratoří DOE. Konsorcium pracuje na uvedení EUV litografie na trh do roku 2006 nebo dříve, kdy se očekává, že budou vyžadována konstrukční pravidla 70 nanometrů (0,07 mikronů). Dohoda zahrnuje závazky quid pro quo určené tichým kritikům, kteří tvrdili, že účast zahraničního dodavatele v EUV LLC bude spočívat v rozdělení duševního vlastnictví vyvinutého v národních laboratořích DOE.

Náměstek ministra energetiky USA Ernest Moniz řekl: „Pokud se technologie EUV ukáže jako životaschopná, ASML souhlasila s výstavbou továrny v USA, podobnou jejímu nizozemskému zařízení, a také se zřízením amerického výzkumného a vývojového centra. Továrna bude dodávat 100 procent veškerého prodeje ASML ve Spojených státech.“

ASML souhlasila s tím, že 55 procent komponent používaných v jejích komerčních EUV systémech prodávaných ve Spojených státech bude pocházet od amerických dodavatelů, což podle Monize udrží vysoce placená pracovní místa ve Spojených státech.

Minoz řekl, že ASML „souhlasil s tím, že pomůže usnadnit pravidelné kontroly mezi členy programu Euclides EUV a americkými výrobci“. Euclides je evropské výzkumné úsilí podporované Evropským společenstvím a založené především na výzkumných a vývojových zařízeních ASML v Eindhovenu. „Spolupráce těchto předních dodavatelů litografických nástrojů na předsoutěžním základě je nejlepším přístupem k posílení celkové technologie a zajištění její mezinárodní akceptace,“ řekl Minoz.

Jim Glaze, výkonný ředitel virtuální národní laboratoře – složené z výzkumníků z národních laboratoří Lawrence Livermore, Sandia a Lawrence Berkeley – uvedl, že dohoda „je nezbytným krokem k dosažení mezinárodního přijetí“ technologie EUV. Američtí vědci z virtuální národní laboratoře i od komerčních partnerů v rámci EUV LLC budou moci sdílet informace s výzkumným úsilím Euclides do EUV.

"Mnoho lidí v posledních několika měsících velmi tvrdě pracovalo na vypracování této dohody," řekl Glaze. "Formalizuje spojení mezi Euclides a EUV LLC."

Intel Corp., jeden ze tří výrobců polovodičů v EUV LLC, usiloval o účast mimoamerických prodejců litografie v konsorciu, uvedl mluvčí Intelu. Motorola Inc. a Advanced Micro Devices Inc. jsou dalšími dvěma dodavateli polovodičů. V oblasti litografie jsou současnými účastníky EUV LLC Silicon Valley Group Lithography (San Jose, Kalifornie), stejně jako dceřiná společnost USAL společnosti Ultratech Stepper Inc. (San Jose).

ASML je zhruba stejně velká jako Canon Inc. v oboru litografie a Nikon Corp. je považována za největšího světového dodavatele litografických systémů. Glaze poznamenal, že všichni tři prodejci polovodičů, kteří se nyní účastní EUV LLC, provozují továrny v zámoří a hledali širší základnu dodavatelů litografie v rámci EUV LLC. Tři výrobci čipů hledají další účastníky z průmyslu, aby se podělili o náklady na vývoj, řekl Glaze.

Na Litografickém workshopu nové generace, který se konal loni v prosinci v Coloradu, hlasování 110 účastníků workshopu dalo přístupu EUV nejvyšší hodnocení jako preferované litografické řešení nové generace v „uzlu 70 nanometrů“ a dále.

Očekává se, že EUV LLC dokončí svůj první prototyp demonstrační litografické platformy v druhé polovině příštího roku. Odhaduje se, že komercializace si v příštích pěti letech vyžádá více než 600 milionů USD investic EUV LLC.